(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株

最終頁に続く

特開平6-256733

(43)公開日 平成6年(1994)9月13日

| (51) Int. Cl. ° | 識別記号 | FI |
|-----------------|--------------------|--|
| C09J 7/02 | JKD 6904-4J | |
| | JHR 6904-4J | |
| • | JLE 6904-4J | - |
| B32B 27/00 | D 8413-4F | |
| | A 8413-4F | • |
| | 審査 | 請求 未請求 請求項の数11 〇L (全8頁) 最終頁に続く |
| (21)出願番号 | 特願平5-241322 | (71)出願人 000003159 |
| (22)出願日 | 平成5年(1993)9月28日 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 (72)発明者・小村・誠 |
| (31)優先権主張番号 | 特願平4-263618 | 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 |
| (32)優先日 | 平4(1992)10月1日 | 式会社滋賀事業場内 |
| (33)優先権主張国 | '日本 (JP) | (72)発明者 与倉 三好 |
| | • | 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 |
| | | 式会社滋賀事業場内 |

• •

式会社滋賀事業場内

(72)発明者 三浦 康男

(54) 【発明の名称】耐熱性接着材料

(57) 【要約】

【構成】本発明は、ポリフェニレンスルファイド樹脂フィルムの少なくとも片面に耐熱性接着剤を有する積層体であって、耐熱性接着剤の少なくとも一方がポリイミド系樹脂であることを特徴とする耐熱性接着材料である。 【効果】本発明によれば、金属、耐熱性樹脂などとの接着が容易に可能な上、加熱時に発生するガス量がきわめて少なく、張り合わせ後の発泡もなく、さらに接着性、耐熱性、電気特性、耐薬品性、低吸水性、寸法安定性が優れた耐熱性接着材料を確実に得ることができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】ボリフェニレンスルファイド樹脂フィルムの少なくとも片面に耐熱性接着剤を有する積層体であって、耐熱性接着剤の少なくとも一方がボリイミド系樹脂であることを特徴とする耐熱性接着材料。

【請求項2】ポリイミド系樹脂が、芳香族テトラカルボン酸と、5モル%以上がシロキサン系ジアミンであるジ

アミン成分とからなるポリアミック酸をイミド化させて 得られる薄膜であることを特徴とする請求項1記載の耐 熱性接着材料。

【請求項3】シロキサン系ジアミンが次の一般式 [I] で表されるものであることを特徴とする請求項2記載の耐熱性接着材料。

【化1】

(ただし、式中nは1以上の整数を示す。またR, およびR, は、それぞれ同一または異なって、低級アルキレン基またはフェニレン基を示し、R, 、R, 、R, およびR, は、それぞれ同一または異なって、低級アルキル基、フェニル基またはフェノキシ基を示す。)

【請求項4】ボリイミド系樹脂のジアミン成分中に、 4、4¹ージアミノジフェニルエーテルを15~50モ ル%含有することを特徴とする請求項1記載の耐熱性接 着材料。

【請求項 5 】少なくとも一方の耐熱性接着剤の厚みが、 0. 1μ m以上 5μ m未満であることを特徴とする請求 項 1 記載の耐熱性接着材料。

【請求項6】少なくとも一方の耐熱性接着剤の250 における粘弾性率が $10'\sim10'$ dyn/cm' であることを特徴とする請求項1 記載の耐熱性接着材料。

【請求項7】少なくとも一方の耐熱性接着剤のガラス転 30 移点が50~200℃であることを特徴とする請求項1 記載の耐熱性接着材料。

【請求項8】ポリフェニレンスルファイド樹脂フィルムの表面が、コロナ放電処理または低温プラズマ処理され ◆ ていることを特徴とする請求項1記載の耐熱性接着材料。

【請求項9】加熱温度100℃以上300℃以下における発生ガス量が250ppm以下であることを特徴とする請求項1記載の耐熱性接着材料。

【請求項10】請求項1記載の耐熱性接着材料をリード 40 フレーム固定用、リードオンチップ用またはヒートスプ レッダー用接着材料として使用する方法。

【請求項11】耐熱性接着剤組成物を、ボリフェニレンスルファイド樹脂フイルムの少なくとも片面に塗布、乾燥した後、200~270℃で熱処理することを特徴とする耐熱性接着材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は耐熱性接着材料に関する ものであり、更に詳しくは高い接着力を有し、かつ寸法 50

安定性に優れる高品位な耐熱性接着材料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電子機器のより小型化、高性能化が進む中で半導体実装分野でも、小型、薄型、軽量、高密度の20 パッケージが求められてきている。

【0003】この半導体実装技術のなかで、部品同志を接合するための高性能の耐熱性接着テープの開発が求めらるようになってきた。

【0004】例えば、リードフレーム上にICチップを 両面接着テープで固定するLOC (lead on chip) 用接 着テープ、またICチップの放熱のためICチップと金 属の放熱板を接着するヒートスプレッダー用接着テープ などである。

【0005】現在この接着テーブは、ボリイミドフィルムの両面にエボキシ系の熱硬化性接着剤を塗工したものが使用されている。このエボキシ系樹脂を、LOC用接着テーブに使用した場合には、NIKKEI MICRODEVICES 1989年9月号などに記載されているごとく、キュア時の発生ガスが基板金属表面を汚染し、接着力低下やパッケージクラック発生原因になる問題がある。

【0006】また、ヒートスプレッダー用に使用した場合には、耐熱性樹脂フィルム接着力が不十分であり、より高密度化が進み発熱量が多く高温になる場合には接着力低下が問題になる。

【0007】この様な状況の中で最近、発生ガスのない、かつ吸水率の低い耐熱性接着剤テープが求められているが、まだ実用化にいたっていない。

【0008】ところで、ボリフェニレンスルファイド樹脂フィルムはその樹脂のもつ耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性などの優れた特性を生かし種々の分野で使用されている。例えば、コンデンサ用、金属箔と接着剤で積層したFPC(フレキシブルブリント基板)、モータ・トランス用絶縁材料、ワイヤー被覆材料などは周知のとおりである。

【0009】この様にボリフェニレンスルファイド樹脂

フィルムは種々の特長を有し、かつその吸水率が低く上 記のような耐熱性接着剤テーブ用途として最適であるに もかかわらず、まだポリフェニレンスルファイド樹脂フィルムに耐熱性接着剤を積層した耐熱性接着剤テーブは 実用化にいたっていない。

【0010】その原因は、周知のとおりボリフェニレンスルファイド樹脂フィルムの表面は化学的に極めて安定で不活性なため、積層した接着剤とボリフェニレンスルファイド樹脂フィルムの接着力が極めて弱いことにある。接着性はボリフェニレンスルファイド樹脂フィルム表面をコロナ放電処理することによって若干は改善されるが実用レベルには達しなく、実用化に至っていないのが現状である。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる従来技術の諸欠点に鑑み創案されたものであって、その目的とするところは、ボリフェニレンスルファイド樹脂フィルムを使用したものでありながら、塗工したボリイミド系接着剤膜とボリフェニレンスルファイド樹脂フィルムの接着力が強固で、加熱時に発生するガス量が極めて少なく、しかも優れた低吸水性、接着性、耐薬品性および寸法安定性を有する耐熱性接着材料を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】かかる本発明の目的は、ボリフェニレンスルファイド樹脂フィルムの少なくとも 片面に耐熱性接着剤を有する積層体であって、耐熱性接着剤の少なくとも一方がボリイミド系樹脂であることを 特徴とする耐熱性接着材料により達成される。本発明に おいて使用されるボリフェニレンスルファイド樹脂フィ ルムとしては、特に限定されず、公知のものが全て使用 できるが、フィルム表面に低温プラズマ処理あるいはコ ロナ放電処理が施されていることが好ましい。これらの 処理を施すことによって、ボリフェニレンスルファイド 樹脂フィルムの接着性を大幅に向上させることができる。

【0013】低温プラズマ処理は、減圧下で行なうことができ、その方法としては、特に限定されないが、例えばドラム状電極と複数の棒状電極からなる対極電極を有する内部電極型の放電処理装置内に被処理基材をセット 40し、処理ガスを0.01~10Torr,好ましくは、0.02~1Torrに調整した状態で電極間に直流あるいは交流の高電圧を印加して放電を行い、前記処理ガスのプラズマを発生させ、該ブラズマに基材表面をさらして処理する方法が挙げられる。低温プラズマ処理の条件としては、処理装置、処理ガスの種類、圧力、電源の周波数などによって異なるが、適宜最適条件を選択することができる。上記処理ガスとしては、特に限定されるものではないが、Ar、N,、He、CO,、CO、空

気、水蒸気、O、などを単独であるいは混合して用いることができる。

【0014】一方、コロナ放電処理は、低温プラズマ処理と比較して接着性向上の効果が小さいので、積層する耐熱性接着剤を選択する必要がある。

【0015】本発明における耐熱性接着材料は、上記ポリフェニレンスルファイド樹脂フィルムの少なくとも片面に耐熱性接着剤を有する積層体であって、耐熱性接着剤の少なくとも一方がポリイミド系樹脂であることを特徴とする。

【0016】本発明において使用されるボリイミド系樹脂としては、芳香族テトラカルボン酸と、5モル%以上がシロキサン系ジアミンであるジアミン成分とを反応させて得られるボリアミック酸からなる薄膜をイミド化してなるものであることが好ましい。

【0017】本発明において使用される芳香族テトラカ ルボン酸としては、3,3¹,4,4¹-ペンゾフェノ ンテトラカルボン酸二無水物、2,2⁻,3,3⁻-ベ ンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,2¹, 3, 3 - ピフェニルテトラカルボン酸二無水物、ピロ メリット酸二無水物、3,3¹,4,4¹ピフェニルテ トラカルボン酸二無水物、2,2⁻,3,3⁻-ピフェ ニルテトラカルボン酸二無水物、2、2-ビス(3.4) ージカルボキシフェニル)プロパン二無水物、2、2-ピス(2,3-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水 物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)エーテルニ 無水物、ビス(3、4-ジカルボキシフェニル)スルホ ン二無水物、1,1-ピス(2,3-ジカルボキシフェ ニル)エタン二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフ エニル) メタン二無水物、2,3,6,7-ナフタレン テトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8-ナフタレ ンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6-ナフタ レンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-ベン ゼンテトラカルボン酸二無水物、3,4,9,10-ペ リレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-ア ントラセンテトラカルボン酸二無水物、1,2,7,8 - フェナントレンテトラカルボン酸二無水物などが挙げ られる。これらは単独であるいは二種以上混合して用い られる。

【0018】ジアミン成分としては、ジアミン成分中にシロキサン系ジアミンを少なくとも5モル%以上含むことが好ましい。さらに好ましくは10モル%以上90モル%以下である。

【0019】本発明において使用されるシロキサン系ジアミンとしては、次の一般式[I]で表されるものが挙げられる。

[0020]

【化2】

4

(ただし、式中nは1以上の整数を示す。またR」およ びR、は、それぞれ同一または異なって、低級アルキレ ン基またはフェニレン基を示し、R、、R、、R、およ びR、は、それぞれ同一または異なって、低級アルキル 基、フェニル基またはフェノキシ基を示す) 一般式 [1] で表されるシロキサン系ジアミンの具体例として は、1, 1, 3, 3ーテトラメチルー1, 3ーピス (4

-アミノフェニル) ジシロキサン、1,1,3,3-テ トラフェノキシー1, 3-ピス (4-アミノエチル) ジ シロキサン、1, 1, 3, 3, 5, 5 - ヘキサメチルー 1, 5-ピス(4-アミノフェニル) トリシロキサン、 1, 1, 3, 3ーテトラフェニルー1, 3ーピス (2-アミノエチル) ジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラ フェニルー1、3ーピス(3-アミノブロピル)ジシロ キサン、1, 1, 5, 5-テトラフェニル-3, 3-ジ メチルー1、5-ビス(3-アミノプロピル)トリシロ キサン、1, 1, 5, 5-テトラフェニル-3, 3-ジ メトキシー1, 5-ビス(4-アミノブチル)トリシロ キサン、1、1、5、5ーテトラフェニルー3、3ージ メトキシー1, 5-ピス (5-アミノペンチル) トリシ ロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメチル-1, 3-ビ ス(2-アミノエチル) ジシロキサン、1,1,3,3 ーテトラメチルー1、3ーピス(3-アミノプロピル) ジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメチル-1, 3 ーピス(4-アミノブチル)ジシロキサン、1,3-ジ メチルー1, 3ージメトキシー1, 3ーピス (4ーアミ ノブチル) ジシロキサン、1、1、5、5、-テトラメ チルー3, 3-ジメトキシー1, 5-ピス(2-アミノ エチル) トリシロキサン、1, 1, 5, 5-テトラメチ ルー3,3ージメトキシー1,5ーピス(4ーアミノブ チル)トリシロキサン、1, 1, 5, 5-テトラメチル -3, 3-ジメトキシ-1, 5-ピス (5-アミノペン チル) トリシロキサン、1, 1, 3, 3, 5, 5-ヘキ 40 サメチルー1, 5-ビス(3-アミノプロピル)トリシ ロキサン、1, 1, 3, 3, 5, 5 - ヘキサエチルー 1, 5-ビス(3-アミノプロピル)トリシロキサン、 1, 1, 3, 3, 5, 5-ヘキサプロピルー1, 5-ビ

ス(3-アミノプロピル)トリシロキサンなどが挙げら れる。上記シロキサン系ジアミンは、単独であるいは二 種以上混合して用いられる。

【0021】シロキサン系ジアミン以外のジアミン成分 としては、4,4~-ジアミノジフェニルエーテル、

ミノジフェニルスルホン、パラフェニレンジアミンなど の公知のものが使用できる。これらの中で、4,4 --10 ジアミノジフェニルエーテルをジアミン成分中に、15 ~50モル%含有して使用した場合、ポリフェニレンス ルファイド樹脂フィルムとの接着性が特異的に優れたも のとなる。したがって、そのようなポリイミド樹脂を耐 熱性接着剤として使用すると、ボリフェニレンスルファ イド樹脂フィルムにコロナ放電処理を施すだけで(低温 プラズマ処理を施さなくても)、十分実用的な耐熱性接 着材料が得られる。

【0022】上記芳香族テトラカルボン酸とジアミンと の反応は、従来公知の方法に準じて行うことができる。 20 例えば、略化学量論量の酸成分とジアミン成分とを、 N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセ トアミド、N-メチル-2ピロリドン等の有機溶媒中 で、0~80℃の温度で反応させれば良い。これらの溶 媒は、単独であるいは2種以上混合して用いられ、ポリ アミック酸が折出しない程度であれば、ベンゼン、トル エン、ヘキサン、シクロヘキサン、テトラヒドロフラ ン、メチルエチルケトン等を加えても良い。

【0023】ボリアミック酸ワニス濃度としては、特に 限定されないが、通常5~60重量%が好ましく、10 30 ~40重量%が特に好ましい。

【0024】ポリフェニレンスルファイド樹脂フィルム を用いて耐熱性接着材料を製造するには、上記ポリアミ ック酸ワニスに代表される耐熱性接着剤組成物をポリフ エニレンスルファイド樹脂フィルムの少なくとも片面に 塗布、乾燥した後、200~270℃で熱処理すればよ い。耐熱性接着剤組成物としてポリアミック酸を使用し た場合の一例について詳細に説明する。

【0025】すなわち低温プラズマ処理あるいはコロナ 放電処理したボリフェニレンスルファイド樹脂フィルム 上に、上記ボリアミック酸ワニスを10~40重量%含 む溶媒溶液を製膜用スリットから吐出させて均一に塗工 する。この塗工方法としてはロールコータ、ナイフコー タ、密封コータ、コンマコータ、ドクタープレードフロ ートコータなどによるものが挙げられる。次に上記のよ うに耐熱性樹脂フィルムに塗工した溶液の溶媒を、通常 60℃以上190℃程度の温度で連続的または断続的に 10~60分間で加熱除去した後、さらにイミド化する ための加熱処理を行なう。イミド化するための加熱処理 としては200~350℃の範囲で1~15分程度の短 4, 4 ージアミノジフェニルメタン、4, 4 ージア 50 時間の加熱処理を行なうことが好ましい。より好ましい

温度範囲としては、200~270℃である。

【0026】 このようにしてボリフェニレンスルファイ ド樹脂フィルム上に耐熱性接着剤層を形成する。その 後、汚染防止、キズ防止などの必要に応じ厚み15~6 0 μ m の ボリエステルフィルム、ボリブロピレンなどの 保護フィルムを、イミド化せしめた薄膜上に張り合わせ ておくことが好ましい。

【0027】ボリフェニレンスルファイド樹脂フィルム 上に形成される耐熱性接着剤の厚みは、通常、0.1~ 40μ m程度であるが、厚みが 0.1μ m以上 5μ m未 10満のもの、好ましくは $0.3 \sim 3 \mu m$ のものは、ワイヤ ボンディング時の超音波による加熱効率が良いので、L 〇C用、ヒートスプレッダー用の接着材料として用いる 場合には好ましく使用される。

【0028】耐熱性接着剤の250℃における粘弾性率 は、10'~10' dyn/cm' であることが好ましい。 よ り好ましくは、5×10'~5×10'dyn/cm'であ る。250℃における粘弾性率が大きすぎると、LOC 用両面接着テープとして使用した場合リードフレームと のラミネート可能になる温度が300℃を越える高温度 20 になるため、例えばヒートスプレッダー用途の銅系の金 属と張り合わせると金属が酸化され接着力の低下などが 問題になる。また、粘弾性率が小さすぎると、半田リフ ロー時の接着力低下が大きくなる。

【0029】また、耐熱性接着剤のガラス転移点 (T g) は、50~200℃であることが好ましい。ガラス 転移点が低い場合には、接合(ラミ)可能温度は低い が、半田リフロー時や樹脂封止温度での接着力低下が大 きくなるので好ましくない。ガラス転移点が高い場合に は、接合(ラミ)可能温度が300℃以上となるので好 30

【0030】本発明による耐熱接着材料の加熱温度10 0~300℃における発生ガス量が250ppm以下で あれば金属箔、耐熱樹脂などと接着した場合の発泡がな いので好ましく、より好ましくは150ppm以下、さ らに好ましくは100ppm以下である。

【0031】ここで、耐熱接着材料の加熱温度100~ 300℃において発生するガス量とは該耐熱接着材料の サンプルについて後述するTG・DTG-MS法

TG: Thermogravimetric Analysis

(熱重量分析)

D'TG: Derivative Thermogravimetric Analysis (微分熱重量分析)

MS: Mass Spectormetry

(質量分析)

により測定して求めたものである。

【0032】本発明にかかる耐熱性接着材料の使用例の 一例としては、耐熱樹脂フィルム同志の積層、金属との 積層が挙げられる。すなわち、銅箔と積層するフレキシ 用接着テーブ、TAB用キャリアテーブなどの種々のリ ードフレーム周辺材料に用いられる。

【0033】具体例としてLOC用両面接着テープに使 用する場合には、本発明品を使用目的の幅にスリット し、ポリイミド樹脂上の保護フィルムを剥がし吸着水分 を除去後、リードフレームと重ね合わせ150℃以上4 50℃で加熱圧着し、さらにICチップを接着固定すれ ば良い。接着力向上のためには、さらに加熱キュアを施 したほうが好ましい。圧着の温度、圧力および加熱キュ アの条件としては、樹脂の組成、膜厚などによって適宜 選択することができる。また、加熱圧着の方法は、ヒー トプレス、加熱ロールなど製造工程により、好ましいも のを選択することができる。

[0034]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明 するが、本発明はこれらに限定されるものではない。な お、以下の説明で発泡、加熱時の発生ガス量、接着力お よび吸水率はそれぞれ次の方法で評価および測定したも のである。

【0035】 [発泡] 銅箔をエッチング除去後、接着剤 表面を光学顕微鏡によって観察した。

【0036】 [発生ガス量] イミド化した薄膜を有する 試料約100mgを精密科学天秤で秤量後、TG・DT G-MS法によって測定した。

【0037】TG・DTG-MS法とは、TG装置にM S装置を直結して、重量変化と同時に、加熱時に試料か ら発生するガスの濃度変化を温度の関数として追跡する 手法である。測定機および測定条件はつぎのとおりであ

【0038】測定機 ;島津製作所(株)製TG(マ クロ天秤)-MS同時測定装置

データ処理;東レリサーチセンター製データ処理システ ∆ "THADAP-TGMS"

測定精度 : 10ppm

測定モード;試料を白金製容器に入れてあらかじめ50 ℃で6時間真空乾燥した後、TG装置にセット後、乾燥 ヘリウムを50m1/分で12時間以上流してから、1 0℃/分で昇温を開始し、400℃までのTG-MS曲 線を測定し、150℃から300℃の発生ガスの総量を 40 求めた。

【0039】 [接着力]

①TAB用

JIS C-6481に準拠し、幅2mmの試料を18 0°剥離をテンシロンにて、引張り速度50mm/分で 測定した。実用的は、0.8kg/cm以上の接着力が 必要とされる。

[0040] ②LOC用

JIS C-6481に準拠し、幅2mmの試料を90 ° 剥離をテンシロンにて、引張り速度50mm/分で測 ブルブリント基板用途、リードフレーム固定用、LOC 50 定した。実用的は、0.8 kg/cm以上の接着力が必

要とされる。

【0041】 [吸水率] 60mm×60mmの試料を用意し、250℃×10分オープン中で乾燥し、重量を精密天秤で測定した(W。)。85℃×85%RH下24時間放置し、重量を測定した(W。)。これから吸水率

(σ)を下記式で算出した。

【数1】

$$\sigma (\%) = \frac{W_1 - W_0}{W_0} \times 100$$

[粘弾性率] 試料 (4 mm×4 0 mm) を23℃、50% RHで、24時間以上調節後測定した。

【0043】測定機および測定条件はつぎのとおりである。

【0044】測定機 ; "RHEO VIBRON" D DV-II-EA [(株) ORIENTEC製]

測定温度;室温~280℃(測定温度間隔;2℃)

駆動周波数;110Hz

実施例1

温度計、攪拌装置、還流コンデンサおよび乾燥N, 吹込口を供えた300mlの4口フラスコにN, Nージメチルアセトアミド139g入れ窒素気流下で1, 1, 3, 3ーテトラメチルー1, 3ーピス (3ーアミノプロピル) ジシロキサン6. 0g (40mol%) および4, 4´ージアミノジフェニルエーテル7. 2g (60mol%) を溶解したあと、3, 3´, 4, 4´ーベンソフ 30 エノンテトラカルボン酸二無水物19. 3gを加え、10℃で1時間攪拌を続けた。その後50℃で3時間攪拌して反応させボリアミック酸ワニスを得た。

【0045】該ワニスをあらかじめAr雰囲気中で低温プラズマ処理した 50μ mのポリフェニレンスルファイド樹脂フィルム(東レ(株)製"トレリナ")に乾燥後の膜厚が 20μ mになるように塗工し、80Cで10分乾燥、さらに130Cで10分乾燥、さらに160Cで15分乾燥した。該塗工品をイミド化するため、220Cで4分加熱処理を施した。該フィルムの発生ガス量を 40測定したところ60pm以下であった。

【0046】上記作製フィルムを、幅30mmにスリット加工し、リードフレーム用金属箔として用いられている42合金と重ね合わせ、表面温度250℃に加熱したロールラミネータで線圧10kg/cm、速度1m/分で張り合わせた。ラミネート品自体、発泡は全く認められず、接着力1.5kg/cm、吸水率0.7%であった。LOC用接着テープとして実用レベルを十分満足するものであった。

[0047] 実施例2

実施例 1 と同様の反応装置にN, N - ジメチルアセトアミド 1 4 6 g入れ窒素気流下で1, 1, 3, 3 - テトラメチル -1, 3 - ビス (3 - アミノブロビル) ジシロキサン 1. 4 g (1 0 m o 1 %) および 4, 4 - - ジアミノジフェニルエーテル 1 0. 2 g (9 0 m o 1 %) を溶解したあと、3, 3 1, 4, 4 1 - ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物 1 8. 3 g を加え、1 0 1 で 1 時

10

間攪拌を続けた。その後、50℃で3時間攪拌して反応 させ、ボリアミック酸ワニスを得た。

10 【0048】該ワニスを実施例1と同様に低温プラズマ処理した75 μ mのポリフェニレンスルファイド樹脂フィルム(東レ(株)製"トレリナ")に乾燥後の膜厚が 10μ mになるように塗工し、80℃で10分乾燥、さらに120℃で10分乾燥、さらに150℃で15分乾燥した。該塗工品をイミド化するため、210℃で5分加熱処理を施した。該フィルムの発生ガス量を測定したところ60pm以下であった。

【0049】上記作製フィルムの樹脂塗工面と、75μmのボリイミドフィルム(東レ・デュボン(株)製"カプトン"300K)と重ね合わせ表面温度250℃に加熱したロールラミネータで線圧7kg/cm、速度1m/分で張り合わせた。張り合わせ品は発泡がなく、接着力は1.5kg/cm、吸水率は0.6%で、接着力の強い張り合わせフイルムが得られた。

【0050】実施例3

【0051】該塗工品をイミド化するため、220℃で3分加熱処理を施した。該フィルムの発生ガス量を測定したところ100ppm以下であった。

【0052】上記作製フィルムを幅30mmにスリットし、リードフレーム用金属箔として用いられている42合金と重ね合わせ、表面温度250℃に加熱したロールラミネータで線圧5kg/cm、速度1m/分で貼り合わせた。ラミネート品自体、発泡は全く認められず、接着カ1.2kg/cm、吸水率0.8%であった。LOC用接着テープとして実用レベルを十分満足するものであった。

0 【0053】実施例4

実施例 1 と同様の反応装置にN, N ージメチルアセトアミド 1 7 5 gを入れ窒素気流下で1, 1, 3, 3 ーテトラメチルー 1, 3 ーピス(3 ーアミノブロピル)ジシロキサン 1 3 . 9 g(7 0 m o 1 %)および 4, 4 ージアミノジフェニルエーテル 3 . 2 g(2 0 m o 1 %)、パラフェニレンジアミン 0 . 9 g(1 0 m o 1 %)を溶解した後、3, 3 , 4, 4 ーベンソフェノンテトラカルボン酸二無水物 2 5 . 8 gを加え、1 0 0 で 1 時間攪拌を続けた。その後、5 0 0 で 3 時間攪拌して反応させポリアミック酸ワニスを得た。

【0054】該ワニスをコロナ放電処理した 50μ mのポリフェニレンスルファイド樹脂フィルム(東レ(株)製"トレリナ")に乾燥後の膜厚が 10μ mになるように塗工し、130℃で2分間乾燥、さらに200℃で2分乾燥した。

【0055】該塗工品をイミド化するため、220℃で3分熱処理を施した。該フィルムの発生ガス量を測定したところ100ppm以下であった。

【0056】上記作製フィルムを幅30mmにスリットし、リードフレーム用金属箔として用いられている42 20合金と重ね合わせ、表面温度250℃に加熱したロールラミネータで線圧5kg/cm、速度1m/分で貼り合わせた。ラミネート品自体、発泡は全く認められず、接着カ1.5kg/cm、吸水率0.8%であった。LOC用接着テープとして実用レベルを十分満足するものであった。

【0057】比較例1

実施例 1 と同様の反応装置にN, N - ジメチルアセトアミド 1 3 9 g入れ窒素気流下で1, 1, 3, 3 - テトラメチル -1, 3 - ビス (3 - アミノプロビル)ジシロキ 30 サン 6. 0 g (40 m o 1%) と 4, 4 - ジアミノジフェニルエーテル 7. 2 g (60 m o 1%) を溶解したあと、3, 3, 4, 4 ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物 1 9. 3 g を加え 1 0 $\mathbb C$ で 1 時間攪拌を続けた。その後 5 0 $\mathbb C$ で 3 時間攪拌して反応させボリアミック酸ワニスを得た。

【0058】該ワニスを低温プラズマ処理しておいた5 0μ mのポリイミドフイルム(宇部興産(株)製"ユーピレックス")に乾燥後の膜厚が 12μ mになるように塗工し80で10分乾燥し、さらに、130で1040分乾燥さらに、1500で15分乾燥した。該塗工品をイミド化のため2500で5分加熱処理を施した。該フィルムの発生ガス量を測定したところ50ppm以下であった。

【0059】上記作製フィルムを、幅30mmにスリット加工し、リードフレーム用金属箔として用いられてい

る42合金と重ね合わせ、表面温度250℃に加熱したロールラミネータで線圧10kg/cm、速度1m/分で張り合わせた。同様に評価したところ、接着力は1.5kg/cmと良好であったが、吸水率は1.5%で該ラミネート品には多数の発泡が認められ、LOC用接着テープとして満足とは言えないものであった。

【0060】実施例5

実施例1と同様の反応装置に、N、N-ジメチルアセト アミド163.05g入れ窒素気流下で1,1,3,3 10 ーテトラメチルー1, 3ーピス(3-アミノプロピル) ジシロキサン21.87g (88mol%) およびp-フェニレンジアミン1. 30g(12mol%)を溶解 したあと、3,31,4,41-ベンゾフェノンテトラ カルボン酸二無水物29.00g(90mo1%) およ びピロメリット酸二無水物 2. 18g (10mol%) を加え、10℃で1時間攪拌を続けた。その後50℃で 3時間攪拌して反応させポリアミック酸ワニスを得た。 【0061】該ワニスを銅箔(35 µm)鏡面上に乾燥 後の膜厚が約20μmになるようにパーコータで塗工後、 80℃で10分乾燥し、さらに、150℃で10分乾燥 さらに、250℃で30分加熱処理を施した。その後銅 箔をエッチング除去し、水洗、乾燥したフィルムの発生 ガス量を測定したところ100ppm以下であった。2 50℃の粘弾性率は、2×10' dyn/cm' であった。 【0062】ワニスをあらかじめ低温プラズマ処理した 70μmのボリフェニレンスルファイド樹脂フィルム ("トレリナ"東レ(株)製)に乾燥後の膜厚が1 μm になるように塗工し80℃で10分乾燥し、さらに、1 20℃で10分乾燥さらに、150℃で15分乾燥し、 さらに210℃で5分加熱処理を施した。該フィルムの 発生ガス量を測定したところ60ppm以下であった。 【0063】上記作製フィルムの樹脂塗工面と、200 μmのリードフレーム用42アロイと重ね合わせ表面温 度250℃に加熱した加熱プレスで圧力10kg/cm *、加熱時間5秒で張り合わせた。接着力は1.2kg /cmであり接着力の強い張り合せ品が得られた。ワイ ヤポンディング後の金線のつぶれ性も良好であった。し OC用接着テープとして実用レベルを十分満足するもの であった。

[0064]

【発明の効果】本発明は、上述のごとく構成したので、 金属、耐熱性樹脂などとの接着が容易に可能な上、加熱 時に発生するガス量がきわめて少なく、張り合わせ後の 発泡もなく、さらに接着性、耐熱性、電気特性、耐薬品 性、低吸水性、寸法安定性が優れた耐熱性接着材料を確 実に得ることができる。

フロントページの続き

(72)発明者 小南 一彦

愛知県名古屋市港区大江町 9 番地の 1 東 レ株式会社名古屋事業場内